PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2003-014458

(43)Date of publication of application: 15.01.2003

(51)Int.CI.

G01C 17/30 G01R 33/02

G01R 33/09

(21)Application number: 2001-204336

(71)Applicant: MATSUSHITA ELECTRIC IND CO

LTD

(22)Date of filing:

05.07.2001

(72)Inventor: ISHIDA TAKAMI

ONAKA KAZUHIRO SEGUCHI SHUJI

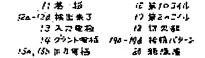
MATSUMURA KAZUTOSHI

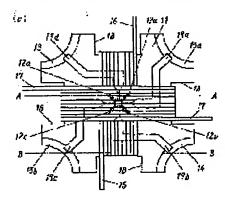
(54) AZIMUTH SENSOR

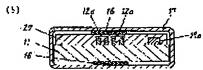
(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a miniaturizable azimuth sensor.

SOLUTION: This azimuth sensor comprises a sheet-like substrate 11; two or more detecting elements 12a-12d provided on the upper face of the substrate 11 and serially mutually connected to be substantially right-angled; an input electrode 13, ground electrode 14 and output electrodes 15a and 15b formed on the peripheral part of the substrate 11 to be connected to the respective double end parts of the detecting elements 12a-12d; a first coil 16 directly wound on the substrate 11 to apply a bias magnetic field to the detecting elements 12a-12d; and a second coil 17 wound on the substrate 11 orthogonally to the first coil 16 to apply a bias magnetic field to the detecting elements 12a-12d.







(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2003-14458 (P2003-14458A)

(43)公開日 平成15年1月15日(2003.1.15)

(51) Int.Cl.7	識別記号	FI		テーマコード(参考)
G01C	17/30	G01C	17/30	A 2G017
G01R	33/02	G 0 1 R	33/02	L
	33/09		33/06	R

審査請求 未請求 請求項の数5 OL (全 8 頁)

(21)出願番号	特顧2001-204336(P2001-204336)	(71)出願人	000005821
			松下電器産業株式会社
(22)出廣日	平成13年7月5日(2001.7.5)		大阪府門真市大字門真1006番地
		(72)発明者	石田 貴巳
			大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器
			産業株式会社内
		(72)発明者	尾中 和弘
			大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器
			産業株式会社内
		(74)代理人	100097445
			弁理士 岩橋 文雄 (外2名)
			最終頁に続く

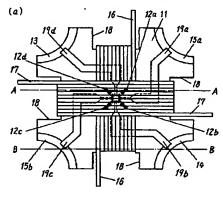
(54)【発明の名称】 方位センサ

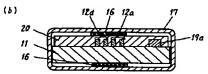
(57)【要約】

【課題】 小形化が可能な方位センサを提供することを 目的とする。

【解決手段】 板状の基板11と、この基板11の上面に設けられ互いに略直角になるように直列に接続された複数の検出素子12a~12dと、この検出素子12a~12dの各両端部と接続され基板11の周縁部に形成された入力電極13、グランド電極14、出力電極15a、15bとを有し、検出素子12a~12dにバイアス磁界が印加されるように基板11に直接巻回された第1のコイル16と、この第1のコイル16と直交しかつ検出素子12a~12dにバイアス磁界が印加されるように基板11に巻回された第2のコイル17とを備えたものである。

11 基 版 16 第1の34ル 12a-12d 検出来子 17 第2の34ル 13 入力電福 18 17 欠都 14 グランド電福 19a-19d 特級パターン 15a,(5b 出力電格 28 軽極層





【特許請求の範囲】

【請求項1】 板状の基板と、この基板の上面に設けられ互いに略直角になるように直列に接続された複数の検出素子と、この検出素子の各両端部と接続され前記基板の周縁部に形成された入力電極、グランド電極、出力電極とを有し、前記検出素子にバイアス磁界が印加されるように前記基板に巻回された第1のコイルと、この第1のコイルと略直交しかつ前記検出素子にバイアス磁界が印加されるように前記基板に巻回された第2のコイルとを備えた方位センサ。

【請求項2】 第1のコイル、第2のコイルのうち少なくとも一方が検出素子を覆うように設けられた請求項1に記載の方位センサ。

【請求項3】 基板の端部に切欠部を有し、第1のコイル、第2のコイルのうち少なくとも一方が前記切欠部内を通るように前記基板に巻回された請求項1に記載の方位センサ。

【請求項4】 入力電極、グランド電極、出力電極はそれぞれ基板の裏面より突出した突出部を有し、その突出寸法は第1のコイルおよび第2のコイルが基板の裏面よ 20り突出した突出寸法より大きくした請求項1に記載の方位センサ。

【請求項5】 基板の裏面に凹部を備え、この凹部内を通るように第1、第2のコイルを巻回し、かつ前記第1、第2のコイルは基板の裏面より上方に位置するように配設し、さらに入力電極、グランド電極、出力電極は前記基板の裏面まで達するようにした請求項1に記載の方位センサ。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は磁気抵抗素子に適当なバイアス磁界を付与し、地磁気を検出して方位を知る方位センサに関するものである。

[0002]

【従来の技術】従来のこの種の方位センサは、図 8 (a)、(b)および図 9 (a)、(b)に示すような 構造となっていた。

【0003】図8(a)は従来の方位センサの斜視図、図8(b)は同上面図、図9(a)は同図8(a)のA-A断面図、図9(b)は同図8(a)のB-B断面図 40である。

【0004】図9(a)に示すように、4個の検出素子 1が板状で絶縁材料からなる基板 2上に備えられている。この検出素子 1は、そのパターンの長手方向に通電すると電気抵抗がパターンに直交する磁界の強さに応じて変化する磁気抵抗効果素子からなる。また、4個の検出素子 1はブリッジ回路を形成しており、その隣り合う検出素子 1はパターンの長手方向が互いに直交しかつ互いに直列に接続されている。さらに、各検出素子 1の各接続部には、この各接続部を入力端子、2つの出力端

子、グランド端子(それぞれ図示せず)に接続するための接続パターン2aが複数設けられている。

【0005】基板2は図9(b)に示すように素子ホルダー3に備えられた設置台部3a上に配置されている。素子ホルダー3には、図8(a)、(b)に示すようにそれぞれ所定巻数の銅線等の絶縁被覆された導電線からなる互いに直交する第1、第2のコイル4a、4bが巻回されている。この第1、第2のコイル4a、4bはそれぞれ各検出素子1に対して45°の方向に位置し、各検出素子1にバイアス磁界を付与している。

【0006】第1のコイル4aは、図9(b)に示すような上下に欠落部3bを有するH字状に構成された素子ホルダー3にこの欠落部3b中を通るように巻回されている。さらに、第2のコイル4bが素子ホルダー3の外周に沿うように第1のコイル4aの外側に巻回し、さらに、第2のコイル4bは方位センサの4隅において第2のコイル4bの下端から上方までの高さを有する図8

(a) に示す棒状部3cの間を通っている。なお、各棒状部3cの下面には方位センサを安定させるための足部3dが設けられている。

【0007】ここで、この方位センサによって方位が検知できる理由について説明する。

【0008】まず、第1のコイル4aによるバイアス磁界と地磁気による磁界との合成磁界が検出素子1に印加されて、この検出素子1の抵抗値が変化し、この抵抗値変化を電圧変化として出力することにより、出力信号が得られる。

【0009】また、方位センサの向いている方向によって、バイアス磁界と地磁気による磁界との合成磁界のベ 30 クトル方向及び大きさが異なるので、検出素子1の抵抗 値変化が異なり、この結果、方位センサの向いている方 向によりこの出力信号は異なる。

【0010】さらに、第1のコイル4 a と直交する第2のコイル4 b によるバイアス磁界についても同様に出力信号が得られる。この第2のコイル4 b は第1のコイル4 a と直交するため、第2のコイル4 b から得られるバイアス磁界と地磁気との合成磁界により得られる検出素子1の出力信号は、第1のコイル4 a から得られるバイアス磁界と地磁気との合成磁界により得られる検出素子1の出力信号と位相が90°ずれている。

【0011】従って、第1のコイル4aから得られるバイアス磁界と地磁気との合成磁界により得られる検出素子1の出力信号と、第2のコイル4bから得られるバイアス磁界と地磁気との合成磁界により得られる検出素子1の出力信号との関係から方位センサの向いている方向が決まり、方位が検知できる。

[0012]

ル4a、第2のコイル4bで巻回しているため形状が大 きくなり、小形化が容易ではなかった。

【0013】本発明は上記従来の課題を解決するもの で、小形化が可能な方位センサを提供することを目的と する。

[0014]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため に本発明は以下の構成を有する。

【0015】本発明の請求項1に記載の発明は、特に、 検出素子にバイアス磁界が印加されるように基板に巻回 10 された第1のコイルと、この第1のコイルと略直交しか つ検出素子にバイアス磁界が印加されるように基板に巻 回された第2のコイルとを備えたという構成を有してお り、これにより、素子ホルダーが不要となるため、小形 の方位センサが得られる。

【0016】さらに、検出素子と第1のコイル、第2の コイルとの距離が短くなるため、各コイルより検出素子 に印加されるバイアス磁界を強くでき、これにより、各 コイルの巻数の軽減もしくは各コイルに流す電流値を抑 制するという容易な方法で、一定値以上のバイアス磁界 20 **量を印加することができるという作用効果を有する。**

【0017】本発明の請求項2に記載の発明は、特に、 第1のコイル、第2のコイルのうち少なくとも一方が検 出素子を覆うように設けられたという構成を有してお り、これにより、第1のコイル、第2のコイルと検出素 子との距離を最短にできるため、第1、第2のコイルよ り発生するバイアス磁界を最も強くでき、さらに、磁界 の方向が検出素子の上下面と平行になるため、検出素子 が受けるバイアス磁界を強くできるという作用効果を有

【0018】本発明の請求項3に記載の発明は、特に、 基板の端部に切欠部を有し、第1のコイル、第2のコイ ルのうち少なくとも一方が切欠部内を通るように基板に 巻回するという構造を有しており、これにより、第1の コイル、第2のコイルを巻回する際、基板に設けられた 切欠部によって、位置ズレの防止や固定することができ るため、第1、第2のコイルの巻崩れ及びたわみを抑制 したり、防止することが可能になるという作用効果を有 する。

【0019】本発明の請求項4に記載の発明は、特に、 入力電極、グランド電極、出力電極はそれぞれ基板の裏 面より突出した突出部を有し、その突出寸法は第1のコ イルおよび第2のコイルが基板の裏面より突出した突出 寸法より大きくしたという構成を有しており、これによ り方位センサの実装時に第1のコイル及び第2のコイル が実装基板に接触せず、面実装が可能になるという作用 効果を有する。

【0020】本発明の請求項5に記載の発明は、特に、 基板の裏面に凹部を備え、この凹部内を通るように第

ルは基板の裏面より上方に位置するように配設し、さら に入力電極、グランド電極、出力電極は前記基板の裏面 まで達するようにしたという構成を有しており、これに より、方位センサの実装時に第1のコイル及び第2のコ イルが実装基板に接触せず、面実装が可能になるという 作用効果を有する。

[0021]

【発明の実施の形態】図1 (a) は本発明の一実施の形 態における方位センサの上面図、図1 (b) は同A-A 線断面図である。

【0022】なお、図1(a)においては、後述する第 1のコイル16と第2のコイル17とによって隠れた検 出素子12a~12d、接続パターン19a~19dを 破線で表わしている。

【0023】図1(a)、(b)において、板状の基板 11と、この基板11の上面に設けられ互いに略直角に なるように直列に接続された複数の検出素子12a~1 2 d と、この各検出素子12 a ~ 12 d の両端部と接続 され基板11の周縁部に形成された入力電極13、グラ ンド電極14、第1、第2の出力電極15a、15bと を有し、検出素子12a~12dにバイアス磁界が印加 されるように基板11に巻回された第1のコイル16 と、この第1のコイル16と直交しかつ検出素子12a ~12 dにバイアス磁界が印加されるように基板11に 巻回された第2のコイル17とを備えている。

【0024】基板11は、矩形状でアルミナなどの絶縁 性を有する材料からなり、その4辺の各端部の中央部に 切欠部18を有している。また、4隅には、入力電極1 3、グランド電極14、第1の出力電極15a、第2の 出力電極15bがそれぞれ設けられている。なお、第1 の出力電極15aと第2の出力電極15bとは互いに向 き合う位置に設けられている。また、入力電極13、グ ランド電極14、第1の出力電極15a、第2の出力電 極15bは銀ーパラジウムで構成され互いに短絡しない ようになっている。なお、これらの電極13、14、1 5a、15bは基板11の4隅に限らず、その周縁部に 設けてもよい。

【0025】さらに、基板11の上面には、その表面を 平滑にするためのガラスグレーズ(図示せず)が設けら れ、さらにその上面には、4個の検出素子12a~12 d、および各検出素子12a~12dと入力電極13、 グランド電極14、第1の出力電極15a、第2の出力 電極15bとをそれぞれ個別に接続させるための接続パ ターン19a~19dが設けられている。なお、ガラス グレーズは入力電極13、グランド電極14、第1の出 力電極15a、第2の出力電極15bの上面の全てを覆 わないようにする。

【0026】検出素子12a~12dは、その各パター ンの長手方向に対して外部磁界が垂直に印加されたとき 1、第2のコイルを巻回し、かつ前記第1、第2のコイ 50 に抵抗値変化が最大となる磁気抵抗効果素子からなり、

5

また、4個の検出素子12a~12dはブリッジ回路を形成しており、そのパターンの長手方向が互いに直交しかつ互いに直列に接続されている。さらに、各検出素子12a~12dの各接続部には、この各接続部を入力電極13、グランド電極14、第1の出力電極15a、第2の出力電極15bに接続するための接続パターン19a~19dが設けられている。

【0027】すなわち、第1の検出素子12aと第2の検出素子12bとの間には第1の出力電極15a、第2の検出素子12bと第3の検出素子12cとの間にはグランド電極14、第3の検出素子12cと第4の検出素子12dとの間には第2の出力電極15b、第4の検出素子12dと第1の検出素子12aとの間には入力電極13がそれぞれ接続パターン19a~19dを介して接続されている。

【0028】なお、図1 (a) においては、各検出素子 12 a ~ 12 d は抵抗値を高くすることによって消費電力を低く抑えられるように2つに折り返した形状になっているが、必ずしもその必要はない。また、各検出素子 12 a ~ 12 d のパターンの長手方向と第1のコイル16及び第2のコイル17とのなす角が45°になるように設けられている。

【0029】入力電極13、グランド電極14は、検出素子12a~12dに所定の電圧を印加するために設けられ、第1、第2の出力電極15a、15bは、この電圧が印加された検出素子12a~12dのバイアス磁界と地磁気との合成磁界による抵抗値変化を電圧変化として出力するために設けられている。

【0030】第1のコイル16は、銅線などの導電材料からなり、検出素子12a~12dのパターンの長手方 30向に対して45°のバイアス磁界を印加できるように基板11に巻回されている。また、第1のコイル16と、基板11、検出素子12a~12dおよび接続パターン19a~19dとの間には、これらを保護するための例えばフェノール系の樹脂からなる絶縁層20(図1

(a) においては図示せず) が設けられている。さらに、この第1のコイル16は上記した検出素子12a~12d、入力電極13、グランド電極14、第1の出力電極15a、第2の出力電極15b、接続パターン19a~19d、絶縁層20およびガラスグレーズが設けら 40れた基板11に直接巻回されている。

【0031】第2のコイル17は銅線などの導電材料からなり、基板11および第1のコイル16の外周部に第1のコイル16に直交するように巻回され、検出素子12a~12dのパターン長手方向に対して45°のバイアス磁界を印加できるように設けられている。

【0032】また、第1、第2のコイル16、17はそれぞれ対向する切欠部18内を通るようになっている。 【0033】なお、第1のコイル16、第2のコイル17の上面に歩め線硬ル掛胀などの保護的(図示せず)を 設け、第1のコイル16、第2のコイル17の劣化を防止してもよい。

【0034】また、第1のコイル16、第2のコイル17は、それぞれ隣り合うコイルどうし、あるいは第1のコイル16と第2のコイル17とが短絡しないようにポリウレタンなどで被覆されている。

【0035】さらに、第1のコイル16、第2のコイル17のうち少なくとも一方が検出素子12a~12dを覆うようになっている。これにより、第1、第2のコイル16、17と検出素子12a~12dとの距離を最短にできるため、第1、第2のコイル16、17より発生するバイアス磁界を最も強くでき、さらに、バイアス磁界の方向が検出素子12a~12dの上下面と平行になるため、検出素子12a~12dの抵抗値変化率が大きくなるため、検出素子12a~12dの出力信号が大きくなり、精度良く方位検知ができる。

【0036】さらにまた、第1、第2のコイル16、17はそれぞれ対向する切欠部18内を通るように基板11を巻回するため、第1、第2のコイル16、17を巻回する際、基板11に設けられた切欠部18によって第1、第2のコイル16、17の各巻き方向すなわち上面視にて長手方向(以下縦方向とする)に垂直な方向(以下横方向とする)に対して各コイル16、17の巻崩れ及びたわみを抑制できる。このとき、第1、第2のコイル16、17の横方向の幅と、切欠部18の幅を一致させれば各コイル16、17が固定されて、各コイル16、17の巻崩れ及びたわみを防止できる。

【0037】また、第1、第2のコイル16、17の横 方向と平行な各切欠部18の面と、第1、第2のコイル 16、17とを接触させれば、各コイル16、17が固 定されて、各コイル16、17の巻崩れ及びたわみを防 止できる。

【0038】このとき、第1、第2のコイル16、17のうち少なくとも一方について対向する切欠部18内を通るように基板11に巻回すれば、切欠部18を有しない方位センサに比べれば上記した効果が期待できる。

【0039】さらにまた、図2(a)、(b)に示すように、基板11の裏面に凹部22を備え、この凹部22内を通るように第1、第2のコイル16、17を巻回し、かつ第1、第2のコイル16、17は基板11の裏面より上方に位置するように配設し、さらに入力電極13、グランド電極14、第1、第2の出力電極15a、15bを、基板11の裏面まで達するようにする。なお、実装基板表面が絶縁性を有していれば、第1、第2のコイル16、17は基板11の裏面より上方、あるいは基板11の裏面と面一となる。

【0033】なお、第1のコイル16、第2のコイル1 【0040】あるいは、図3に示すように入力電極17の上面に紫外線硬化樹脂などの保護膜(図示せず)を 50 3、グランド電極14、第1の出力電極15a、第2の

出力電極15bは、それぞれ基板11の裏面より突出し た突出部21を有し、その突出部21の寸法は、第1の コイル16および第2のコイル17が基板11の裏面よ り突出した突出寸法より大きくした構造にしてもよい。 ここで、図3は図1 (a) のB-B線断面図に相当す る。

【0041】このようにすれば、方位センサの実装時に 第1のコイル16及び第2のコイル17が実装基板に接 触しないため、入力電極13、グランド電極14、第1 の出力電極15a、第2の出力電極15bの裏面を実装 基板に接続させることができ、これにより、面実装が可 能になる。

【0042】以下、本実施の形態における方位センサの 製造方法について説明する。

【0043】まず、図4(a)、(b)に示すように、 矩形状で板状のアルミナなどの絶縁性を有する材料から なる基板11の4隅にスルーホール電極からなる入力電 極13、グランド電極14、第1、第2の出力電極15 a、15bを形成する。これらの電極13、14、15 a、15bは銀ーパラジウムで構成され、かつ基板11 の上面からスルーホールの内側面を経由して基板 1 1 の 裏面まで至るように形成される。さらに、基板11には 4辺の略中央部に4つの切欠部18を形成する。なお、 図4(a)は上面図、図4(b)は裏面図を示す。ま た、以下の製造方法を示す図においては裏面図を省略す る。

【0044】次に、入力電極13、グランド電極14、 出力電極15a、15bの上面の全てを覆わないように 基板11の上面にガラスグレーズ (図示せず) を形成す

【0045】次に、図5に示すように、ガラスグレーズ 上に4個の磁気抵抗効果素子からなる検出素子12a~ 12dおよび各検出素子12a~12dと入力電極1 3、グランド電極14、第1の出力電極15a、第2の 出力電極 1 5 b とをそれぞれ個別に接続させるための接 続パターン19a~19dを形成する。

【0046】このとき、検出素子12a~12dでブリ ッジ回路を構成させ、そのパターンの長手方向が互いに 直交しかつ互いに直列に接続する。さらに、各検出素子 12a~12dの各接続部には、この各接続部を入力電 40 極13、グランド電極14、第1の出力電極15a、第 2の出力電極15bに接続するための接続パターン19 a~19dを形成する。

【0047】次に、基板11、検出素子12a~12d および接続パターン19a~19dの上面に、これらを 保護するためのフェノール系の樹脂などからなる絶縁層 20 (図示せず)を形成する。

【0048】次に、図6に示すように、銅線などの導電 材料からなる第1のコイル16を、検出素子12a~1 2 d のパターン長手方向に対して45°のバイアス磁界 50 a~12 dにバイアス磁界が印加されるように第1のコ

を印加できるように設ける。また、この第1のコイル1 6は、上記した検出素子12a~12d、入力電極1 3、グランド電極14、第1の出力電極15a、第2の 出力電極15b、接続パターン19a~19d、絶縁層 20およびガラスグレーズが設けられた基板11に直接 巻回する。なお、図6においては第1のコイル16で隠 れた検出素子12a~12d、接続パターン19a~1 9 dを破線で表している。

【0049】最後に、図7に示すように基板11、第1 のコイル16の外周部に第1のコイル16に直交するよ うに銅線などの導電材料からなる第2のコイル17を巻 回する。

【0050】このとき、第1、第2のコイル16、17 はそれぞれ対向する切欠部18内を通るようにし、検出 素子12a~12dのパターン長手方向に対して45° のバイアス磁界を印加できるように設ける。

【0051】上記のようにして、本発明の一実施の形態 における方位センサは製造されるものである。

【0052】以下、本実施の形態における方位センサの 動作について説明する。

【0053】まず、第1のコイル16によるバイアス磁 界と地磁気による磁界との合成磁界が検出素子12a~ 12 dに印加されて、この検出素子12 a~12 dの抵 抗値がそれぞれ変化し、この抵抗値変化を電圧変化とし て出力することにより出力信号が得られる。

【0054】また、方位センサの向いている方向によっ て、バイアス磁界と地磁気による磁界との合成磁界のベ クトル方向及び大きさが異なるので、検出素子12a~ 12 dの抵抗値変化が異なり、この結果、方位センサの 向いている方向によりこの出力信号は異なる。

【0055】さらに、第1のコイル16と直交する第2 のコイル17についても同様に出力信号が得られる。こ の第2のコイル17は第1のコイル16と直交するた め、第2のコイル17から得られるバイアス磁界と地磁 気との合成磁界により得られる検出素子12a~12d の出力信号は、第1のコイル16から得られるバイアス 磁界と地磁気との合成磁界により得られる検出素子12 a~12dの出力信号と位相が90°ずれている。

【0056】従って、第1のコイル16から得られるバ イアス磁界と地磁気との合成磁界により得られる検出素 子12a~12dの出力信号と、第2のコイル17から 得られるバイアス磁界と地磁気との合成磁界により得ら れる検出素子12a~12dの出力信号との関係から方 位センサの向いている方向が決まり、方位が検知でき

【0057】以上のように本実施の形態における方位セ ンサは、検出素子12a~12dにバイアス磁界が印加 されるように基板11に巻回された第1のコイル16 と、この第1のコイル16と略直交しかつ検出素子12

30

9

イル16に巻回された第2のコイル17とを備えたという構成を有しているため、素子ホルダーが不要となり、これにより、小形化が可能な方位センサが得られ、さらに、従来と比べて検出素子12a~12dと第1のコイル16、第2のコイル17との距離が短くなるため、各コイル16、17より検出素子12a~12dに印加されるバイアス磁界を強くでき、これにより、各コイル16、17の巻数の軽減もしくは各コイル16、17に流す電流値を抑制するという容易な方法で、一定値以上のバイアス磁界位を印加することができるという効果が得10られる。

【0058】なお、本実施の形態においては、検出素子を4個としたが少なくとも2個以上であれば、各検出素子の両端部に入力電極、出力電極、グランド電極を設けることができるため、方位の検知ができ同様の効果が得られる。

[0059]

【発明の効果】以上のように本発明によれば、検出素子にバイアス磁界が印加されるように基板に巻回された第 1のコイルと、この第1のコイルと略直交しかつ検出素 20 子にバイアス磁界が印加されるように第1のコイルに巻回された第2のコイルとを備えたという構成を有しており、これにより、素子ホルダーが不要となるため、小形化が可能な方位センサが得られるという効果を有するものである。

【図面の簡単な説明】

10 【図1】(a) 本発明の一実施の形態における方位セン サの上面図

(b) 同A-A線断面図

【図2】(a)同裏面図

(b) 同側面図

【図3】同他の例を示す断面図

【図4】(a)同製造工程を示す上面図

(b) 同製造工程を示す裏面図

【図5】同製造工程を示す上面図

【図6】同製造工程を示す上面図

【図7】同製造工程を示す上面図

【図8】(a)従来の方位センサの斜視図

(b) 同上面図

【図9】 (a) 同図8 (a) のA-A断面図

(b) 同図8 (a) のB-B断面図

【符号の説明】

11 基板

12a~12d 検出素子

13 入力電極

20 14 グランド電極

15a、15b 出力電極

16 第1のコイル

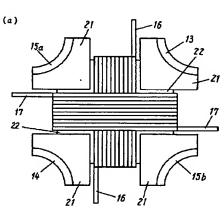
17 第2のコイル

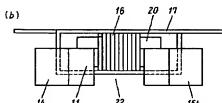
18 切欠部

2 1 突出部

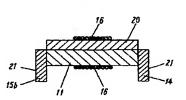
22 凹部

【図2】

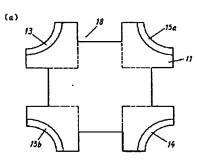


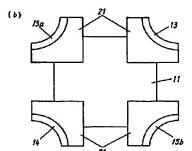


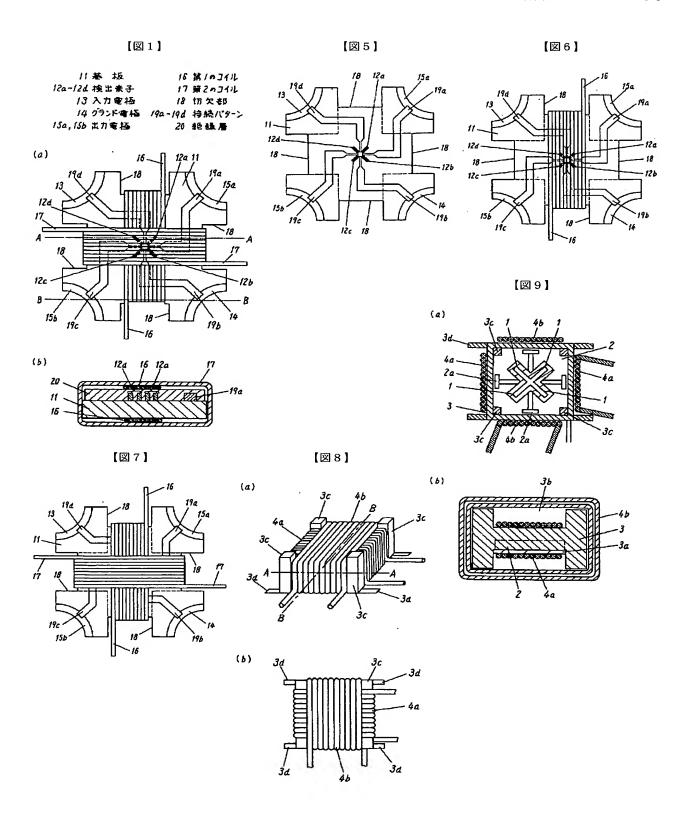
【図3】



【図4】







フロントページの続き

(72) 発明者 瀬口 修次

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内 (72)発明者 松村 和俊

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内

Fターム(参考) 2G017 AA01 AA16 AC09 AD55 BA00